

s 2018 0098

Изобретение относится к области полимерных наноматериалов и фоточувствительных структур на их основе, которые могут быть использованы в оптоэлектронике для создания фотогальванических устройств и электрофотографических носителей информации.

Фоточувствительный слой на основе карбазольного полимера содержит поли-N-эпоксипропилкарбазол или сополимер карбазолил-этилметакрилат:октилметакрилат сенсibilизированный 12...15 масс. % 2,4,7-тринитрофлуоренона и 5,0...50,0 масс. % тетрагидроксифталоцианина цинка или кобальта, толщина фоточувствительного слоя составляет 2,0...6,0 мкм.

П. формулы: 1

Фиг.: 4